ETHYLENE TRIMERIZATION CATALYST AND METHOD FOR TRIMERIZING ETHYLENE USING THE SAME

Publication number: JP2002102710
Publication date: 2002-04-09

Publication date: 2002-04-09
Inventor: YOSHIDA (

YOSHIDA OSAMU; OKADA HISANORI; YAMAMOTO

TOSHIHIDE; MURAKITA YOSHIYUKI

Applicant: TOSOH CORP

Classification:

- international: B01J31/22; C07B61/00; C07C2/32; C07C11/107;

C07B61/00; B01J31/16; C07B61/00; C07C2/00; C07C11/00; C07B61/00; (IPC1-7): C07B61/00;

B01J31/22; C07C2/32; C07C11/107

- European:

Application number: JP20000302871 20000929 Priority number(s): JP20000302871 20000929

Report a data error here

Abstract of JP2002102710

PROBLEM TO BE SOLVED: To efficiently produce 1-hexene from ethylene with high selectivity. SOLUTION: A catalyst used in the production is obtained by bringing a chromium complex with a coordinated neutral multidentate ligand having a tripod structure represented by the formula ACrBn (1) (where (n) is an integer of 1-3; A is the neutral multidentate ligand having a tripod structure; Cr is a chromium atom; and B is one or more selected from the group consisting of H, halogen and a linear or branched alkyl) and an alkyl metallic compound into contact with each other under >=10 kg/cm2 partial pressure of ethylene.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-102710 (P2002-102710A)

最終質に続く

(43)公開日 平成14年4月9日(2002.4.9)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	F I	テーマコード(参考)
B 0 1 J	31/22		В 0 1 Ј 31/22	Z 4G069
C 0 7 C	2/32		C 0 7 C 2/32	4H006
	11/107		11/107	4H039
# C07B	61/00	300	C 0 7 B 61/00	300

審査請求 未請求 請求項の数5 〇L (全 9 頁)

(21)出願番号	特願2000-302871(P2000-302871)	(71)出闢人	*****
		八八田殿ン	000003300
			東ソー株式会社
(22)出顧日	平成12年9月29日(2000.9.29)		山口県新南陽市開成町4560番地
		(72)発明者	吉田 統
			三重県桑名市新西方 5304
		(72)発明者	岡田 久則
			三重県四日市市垂坂町366-1
		(72)発明者	山本 敏秀
			三重県四日市市別名3 丁目5-1
		(72)発明者	村北 栄之
			三重県四日市市別名3 『目4-1

(54) 【発明の名称】 エチレンの三量化触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法

(57)【要約】

【課題】 エチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造する。

【解決手段】

 $ACrB_n$

(1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を、エチレン分圧が10kg/cm²以上の加圧下において接触させることにより得られる触媒を用いる。

【特許請求の範囲】

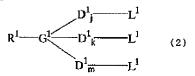
【請求項1】エチレン分圧が10kg/cm²以上の加圧下において、下記一般式(1)

$$ACrB_n$$
 (1)

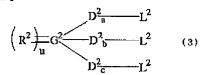
(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させることにより得られるエチレンの三量化触媒。

【請求項2】三脚型構造を有する中性の多座配位子が、 下記一般式(2)

【化1】



(式中、j,k,mはそれぞれ独立して0~6の整数である。Diはそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、Liはそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、Giは炭素またはケイ素、Riは水素原子、炭素数1~10のアルキル基または炭素数6~10のアリール基を表す。)または下記一般式(3)【化2】



(式中、a, b, cはそれぞれ独立して0~6の整数であり、uは0または1の整数である。D²はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L²はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G²は窒素原子またはリン原子、R²は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子であることを特徴とする請求項1に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項3】三脚型構造を有する中性の多座配位子が f a c i a l に配位したクロム錯体を用いることを特徴とする請求項1または2に記載のエチレンの三量化触媒。 【請求項4】アルキル金属化合物が、下記一般式(4) R_pMX_q (4)

(式中、pは0<p≤3であり、qは0≤q<3であって、しかもp+qは1~3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシド基、アリ

ール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化合物であることを特徴とする請求項1~3に記載のエチレンの三量化触媒。

【請求項5】請求項1~4のいずれかに記載のエチレン の三量化触媒の存在下で、エチレンを三量化することを 特徴とするエチレンの三量化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エチレンの三量化 触媒及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法に関す る。さらに詳しくは、線状低密度ポリエチレン(LLD PE)の原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエ チレンから効率よく、かつ高選択的に製造するエチレン の三量化触媒、及びその触媒を用いたエチレンの三量化 方法に関する。

[0002]

【従来の技術】エチレンを三量化して1-ヘキセンを得る方法において、クロム化合物を触媒として用いることは公知である。例えば、特開昭62-265237号公報にはクロム化合物、ボリヒドロカルビルアルミニウムオキシド及びドナー配位子からなる触媒系が開示されている。特開平6-239920号公報には、クロム化合物、ピロール含有化合物、金属アルキル化合物及びハライドからなる触媒系が、また特開平8-59732号公報には、クロム化合物、金属アルキル化合物及び酸アミドまたはイミド化合物からなる触媒系が開示されている。

【0003】また、特開平6-298673号公報には、クロミウム塩の多座配位子であるホスフィン、アルシン及び/またはスチビンとの配位錯体とアルミノキサンからなる触媒が開示されている。さらに、特開平10-7712号公報には、特定の窒素配位子が配位したクロムの塩素錯体やアルキル錯体とアルミニウム化合物からなる触媒が、特開平10-231317号公報には、環状ポリアミンまたはヒドロトリス(ピラゾリル)ボレートが配位したクロム錯体とアルキルアルミニウム化合物からなる触媒が開示されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特開昭62-265237号公報に記載の方法では、1-ヘキセンと同時にポリエチレンが多く副生する欠点がある。特開平6-239920号公報に記載の方法は、ポリエチレンの副生が少なく、この点ではかなり改善しているが、触媒の構成成分であるピロール含有化合物は、空気に対して極めて不安定な物質であるため着色して劣化しやすいため取り扱いが難しく、更に反応終了後には着色成分を除去するための処理または新たな装置を必要とする等、工業的な触媒としては十分なものではなかった。特開平8-59732号公報に記載の方法では、触媒の構成成分である酸アミドまたはイミド化合物の化合物群の中で

活性を得るには、ある特定のイミド化合物(マレイミド)を用いる必要がある。マレイミドは溶解性が低いため触媒調製が煩雑であり、マレイミドは入手が難しいばかりか高価であり、経済性の面においても問題がある。特開平6-298673号公報に記載の方法では、実施例の再現性に問題がある。特開平10-7712号公報に記載の方法は、触媒活性が低いという問題がある。特開平10-231317号公報に記載の方法は、ポリエチレンの生成が多く、オリゴマー中の1-ヘキセン選択性も低いという欠点がある。

【0005】本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的はLLDPEの原料コモノマーとして有用な1-ヘキセンをエチレンから効率よく、かつ高選択的に製造し、しかも取り扱いの容易なエチレンの三量化触媒、及びこの触媒を用いたエチレンの三量化方法を提供することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、上記の課題を解決するため鋭意検討を行った結果、エチレン分圧が10kg/cm²以上の加圧下において、特定の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物との接触によって得られる三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いると高い活性でエチレンの三量化反応が進行し、高選択的に1-ヘキセンが生成することを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0007】即ち本発明は、エチレン加圧下において、 三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム 錯体とアルキル金属化合物との接触によって得られるエ チレンの三量化触媒及びそれを用いたエチレンの三量化 方法に関する。

[8000]

【発明の実施の形態】次に、本発明についてさらに詳し く説明する。

【0009】本発明においては、エチレンの三量化触媒 を構成する一成分として、下記一般式(1)

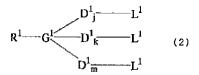
$$ACrB_n$$
 (1)

(式中、nは1~3の整数である。Aは三脚型構造を有する中性の多座配位子であり、Crはクロム原子、Bは水素原子、ハロゲン原子、及び直鎖もしくは分岐状のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体が用いられる。

【0010】ここで、クロム錯体に配位させる三脚型構造を有する中性の多座配位子として用いられるものは特に限定されないが、例えば、下記一般式(2)

[0011]

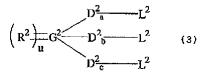
【化3】



【0012】(式中、j,k,mはそれぞれ独立して0~6の整数である。D」はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、L」はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、G」は炭素またはケイ素、R」は水素原子、炭素数1~10のアルキル基または炭素数6~10のアリール基を表す。)または下記一般式(3)

[0013]

【化4】



【0014】(式中、a, b, c はそれぞれ独立して0~6の整数であり、u は0または1の整数である。 D^2 はそれぞれ独立して置換基を有していてもよい2価の炭化水素基、 L^2 はそれぞれ独立して周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基を表す。また、 G^2 は窒素原子またはリン原子、 R^2 は酸素原子またはイオウ原子を表す。)で示される三座配位子が好適なものとして挙げられる。

【0015】上記一般式(2)及び(3)において、D¹及びD²としては特に限定されるものではないが、例えば、アルキレン基、シクロアルキレン基、フェニレン基、トリレン基、キシリレン基等が挙げられる。また、その置換基としては、例えば、メチル基、エチル基等のアルコキシ基類等が挙げられる。

【0016】一般式(2)及び(3)において、L¹及びL²で示される周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する置換基は特に限定されるものではないが、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基等のアルコキシ基類、フェノキシ基、2、6ージメチルフェノキシ基等のアリールオキシ基類、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブチルチオ基等のアルキルチオ基類、フェニルチオ基、ブリルチオ基等のアリールチオ基類、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ビス(トリメチルシリル)アミノ基等のジアルキルアミノ基類、ジフェニルアミノ基等のジアルキルアリールアミノ基類、ジメチルフェニル基等のアルキルアリールアミノ基類、ジメチルホスフィノ基、ジエチルホスフィノ基等のジアルキルホスフィノ基等のジアリールホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基等のジアリールホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基等のジアリールホスフィノ基、ジトリルホスフィノ基等のジアリールホスフィノ基

スフィノ基類、メチルフェニルホスフィノ基等のアルキルアリールホスフィノ基類が挙げられる。

【0017】また、フリル基、ベンゾフリル基、チエニル基、ベンゾチエニル基、ピラゾリル基、トリアゾリル基、デトラゾリル基、ビリジル基、イミダゾリル基、ベンゾイミダゾリル基、インダゾリル基、キノリル基、イソキノリル基、オキサゾリル基、チアゾール基等の周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基類が挙げられる。これらの複素環基類の環上の置換基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、オクチル基、フェニル基等が挙げられる。

【0018】一般式(2)におけるRIは特に限定されるものではないが、例えば、水素原子、メチル基、エチル基、プロビル基、ブチル基、ベンジル基、ヒドロキシメチル基、シアノエチル基、アリル基、トリフルオロプロビル基等の炭素数1~10のアルキル基類、またはフェニル基、pーメチルフェニル基、pークロロフェニル基等の炭素数6~10のアリール基類が挙げられる。

【0019】上記一般式(2)及び(3)で示される三 脚型構造を有する中性の三座配位子は特に限定されるも のではないが、例えば、周期表14族、15族、16族 または17族元素を含有する置換基を持つ多座配位子と しては、トリス (メトキシメチル) メタン、1, 1, 1 ートリス (メトキシメチル) エタン、1、1、1ートリ ス (メトキシメチル) プロパン、1、1、1ートリス (メトキシメチル) ブタン、1,1,1-トリス (エト キシメチル) エタン、1,1,1-トリス (プロポキシ メチル) エタン、1, 1, 1-トリス (ブトキシメチ エタン等の含酸素三座配位子類、1,1,1-トリス (メチルチオメチル)エタン、1,1,1-トリス(ブ チルチオメチル) エタン、1、1、1-トリス (フェニ ルチオメチル) エタン等の含イオウ三座配位子類、1. 1, 1-1,1-トリス(ジフェニルアミノメチル)エタン等の 含窒素三座配位子類、1,1,1-トリス(ジフェニル ホスフィノメチル) エタン、1,1,1-トリス (ジメ チルホスフィノメチル) エタン、1,1,1-トリス (ジエチルホスフィノメチル) エタン等の含リン三座配 位子類が挙げられる。

【0020】さらに、周期表14族、15族、16族または17族元素を含有する複素環基を持つ多座配位子としては、トリフリルメタン、トリス(5ーメチルー2ーフリル)メタン、トリス(5ーブチルー2ーフリル)メタン、1,1,1ートリフリルエタン、トリフリルアミン、トリフリルホスフィン、トリフリルホスフィンオキシド等の含酸素三座配位子類、トリス(チエニル)メタン等の含イオウ三座配位子類、トリス(ピラゾリル)メタン、トリ

ス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージイソプロピルー1ーピラゾリル)メタン、トリス(3,5ージフェニルー1ーピラゾリル)メタン、1,1,1ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)エタン、1,1,1ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)プロバン、1,1,1ートリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)ブタン、トリス(2ーピリジル)メタン、トリス(6ーメチルー2ーピリジル)メタン、トリス(2ーピリジル)カス(2ーピリジル)ホスフィン、トリス(2ーピリジル) ホスフィンオキシド、トリス(2ーピリジル)よタン等の含窒素三座配位子類が挙げられる。

【0021】本発明において、上記一般式(1)のBで用いられるハロゲン原子は特に限定されるものではないが、例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子またはヨウ素原子等が挙げられる。また、直鎖もしくは分岐状のアルキル基としては特に限定されるものではないが、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基またはフェニル基等が挙げられる。

【0022】上記一般式(1)で示されるクロム錯体の 具体的な例としては特に限定されるものではないが、例 えば、トリス (メトキシメチル) メタンクロムトリクロ ライド(III)、トリス(メトキシメチル)メタンク ロム (ベンジル) ジクロライド (III)、1、1、1 ートリス (メトキシメチル) エタンクロムトリクロライ ド(III)、1,1,1-トリス(エトキシメチル) エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-トリス (プトキシメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、1,1,1-トリス(フェノキシメチル) エタンクロムトリクロライド (III)、トリフリルメ タンクロムトリクロライド(III)、1,1,1-ト リス (メチルチオメチル) エタンクロムトリクロライド **(ⅠⅠⅠ)、1,1,1-トリス(ジメチルアミノメチ** ル) エタンクロムトリクロライド(III)、トリス (ピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (II I)、トリス(3,5ージメチルー1ーピラゾリル)メ タンクロムトリクロライド(III)、トリス(3.5 ージメチルー1ーピラゾリル) メタンクロム (ヒドリ ド) ジクロライド(III)、トリス(3,5-ジメチ ルー1ーピラゾリル) メタンクロム (ベンジル) ジクロ ライド(III)、トリス(3,5-ジメチルー1ーピ ラゾリル) メタンクロム (エチル) ジクロライド (II I)、トリス(3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)メ タンクロムトリベンジル(III)、1,1,1-トリ ス(3,5-ジメチルー1-ピラゾリル)エタンクロム トリクロライド(III)、トリス(3,5-ジイソプ ロピルー1ーピラゾリル) メタンクロムトリクロライド (I I I) 、トリス(3,5-ジフェニルー1-ピラゾ

リル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2ーピリジル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(6ーメチルー2ーピリジル)メタンクロムトリクロライド(III)、トリス(2ーピリジル)アミンクロムトリクロライド(III)、トリス(1ーイミダゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1ートリス(ジメチルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1ートリス(ジフェニルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)、1,1,1ートリス(ジエチルホスフィノメチル)エタンクロムトリクロライド(III)等が挙げられる。

【0023】これらのうち触媒活性の面から、一般式(1)で示される三脚型構造を有する中性の多座配位子としては、複素環基を持つ含窒素三座配位子類が好ましく用いられ、より好ましくはトリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)メタンが用いられる。また、Bとしてはハロゲン原子が好ましく用いられる。さらに好ましい三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体としては、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)等が用いられる。

【0024】本発明において、上記の三脚型構造を有す る中性の多座配位子が配位したクロム錯体の合成法は特 に限定されるものではないが、例えば、多座配位子とク ロム化合物とから公知の錯体形成法 [例えば、 Inor g. Chem., 25, 1080 (1986) 等] によ り容易に合成することができる。この場合、使用できる クロム化合物としては特に限定されるものではないが、 例えば、塩化クロム(III)、塩化クロム(II)、 臭化クロム(III)、臭化クロム(II)、ヨウ化ク ロム(III)、ヨウ化クロム(II)、フッ化クロム (I I I)、フッ化クロム(I I)、トリス(テトラヒ ドロフラン) クロムトリクロライド(III)、トリス (1,4-ジオキサン)クロムトリクロライド(II I)、トリス(ジエチルエーテル)クロムトリクロライ ド(III)、トリス(ビリジン)クロムトリクロライ ド(III)、トリス(アセトニトリル)クロムトリク ロライド(III)等が挙げられる。

【0025】前記の多座配位子とクロム化合物を反応させ、クロム錯体を形成させる際のクロム金属の濃度は特に制限されない。また、ここで用いられる溶媒としては特に限定されるものではないが、有機溶媒が好ましく用いられる。例えば、ペンタン、ヘキサン、ヘプタン、オクタン、ノナン、デカン、シクロヘキサン、デカリン等の脂肪族炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、クメン、トリメチルベンゼン等の芳香族炭化水素類、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル類、塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン化炭化水素類が挙げられる。また、上記溶媒はそれぞれ

単独で使用し得るのみならず、二種以上を混合して用いることも可能である。

【0026】また、錯体形成反応は、-80℃から使用する反応溶媒の沸点までの任意の温度で行われ、好ましくは20~200℃である。反応溶媒の沸点以上の温度で錯形成反応を行う場合には、加圧下で行うこともできる。反応時間は特に制限されず、通常1分~48時間、好ましくは5分~24時間である。なお、反応時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0027】さらに別途合成法として、上記の方法により合成した三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロムハロゲン錯体を原料に、アルキル金属化合物や金属ヒドリド化合物を溶媒中で反応させて、本発明の三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体を合成してもよい。

【0028】多座配位子が配位したクロム錯体は、通常 固体として沈殿するので、ろ別により反応溶媒から分離 できる。さらに、必要に応じて、上記溶媒を用いて洗浄 を行い、次いで乾燥してエチレンの三量化触媒の構成成 分の一つであるクロム錯体が合成される。なお、沈殿し ない場合は、溶媒留去、貧溶媒の添加あるいは冷却処理 等により沈殿させることができる。

【0029】本発明においては、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体のうち、その多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることが好ましい。多座配位子がfacialに配位したクロム錯体を用いることにより、ボリエチレンの副生が抑えられる等の効果が認められる。ここで、多座配位子がfacialに配位した錯体とは、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体の異性体の一つである「化学選書 有機金属化学-基礎と応用ー、143頁(裳華房)」。即ち、多座配位子により3つの配位座が占有された6配位八面体型錯体において、多座配位子が、3つの配位座が互いにシス位になるような配置で配位していることを意味する。

【0030】本発明において使用されるアルキル金属化 合物は特に限定されるものではないが、例えば、下記一 般式(4)

$R_p M X_q \qquad (4)$

(式中、pは0 < p≤3であり、qは0 ≤ q < 3であって、しかも p + qは1 ~ 3である。Mはリチウム、マグネシウム、亜鉛、ボロンまたはアルミニウムを表し、Rは炭素数1~10のアルキル基からなる群より選ばれる1種以上を表し、Xは水素原子、アルコキシド基、アリール基及びハロゲン原子からなる群より選ばれる1種以上を表す。)で示される化合物が好適なものとして挙げられる。上記一般式(4)において、炭素数1~10のアルキル基は特に限定されるものではないが、例えば、

メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、シクロへキシル基またはオクチル基等が挙げられる。アルコキシド基としては特に限定されるものではないが、例えば、メトキシド基、エトキシド基、ブトキシド基またはフェノキシド基等が挙げられる。アリール基としては特に限定されるものではないが、例えば、フェニル基等が挙げられる。ハロゲン原子としては特に限定されるものではないが、例えば、フッ素、塩素、臭素またはヨウ素が挙げられる。

【0031】なお、上記一般式(4)において、MがA 1で、pと qがそれぞれ1. 5のとき、 $A1R_{1.5}X_{1.5}$ となる。このような化合物は、理論的には存在しない が、通常、慣用的に $A1_2R_3X_3$ のセスキ体として表現 されており、これらの化合物も本発明に含まれる。

【0032】上記一般式(4)で示されるアルキル金属 化合物としては、例えば、メチルリチウム、エチルリチ ウム、プロピルリチウム、n-ブチルリチウム、sec ープチルリチウム、tert-ブチルリチウム、ジエチ ルマグネシウム、エチルブチルマグネシウム、エチルク ロロマグネシウム、エチルブロモマグネシウム、ジメチ ル亜鉛、ジエチル亜鉛、ジブチル亜鉛、トリメチルボラ ン、トリエチルボラン、トリメチルアルミニウム、トリ エチルアルミニウム、トリーnーブチルアルミニウム、 トリイソブチルアルミニウム、トリーnーヘキシルアル ミニウム、トリーnーオクチルアルミニウム、トリシク ロヘキシルアルミニウム、ジメチルエチルアルミニウ ム、ジエチルアルミニウムヒドリド、ジイソブチルアル ミニウムヒドリド、ジエチルアルミニウムエトキシド、 ジエチルアルミニウムフェノキシド、ジシクロヘキシル フェニルアルミニウム、エチルアルミニウムエトキシク ロリド、ジエチルアルミニウムクロリド、ジエチルアル ミニウムブロミド、ジイソブチルアルミニウムクロリ ド、ジシクロヘキシルアルミニウムクロリド、メチルア ルミニウムセスキクロリド、エチルアルミニウムセスキ クロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、エチル アルミニウムジクロリド、イソブチルアルミニウムジク ロリド等が挙げられる。これらのうち入手の容易さ及び 活性の面から、トリアルキルアルミニウム化合物が好ま しく用いられ、さらに好ましくはトリエチルアルミニウ ム、トリーnーブチルアルミニウム、トリイソブチルア ルミニウム、トリーカーヘキシルアルミニウムやトリー n-オクチルアルミニウム等が用いられる。これらのア ルキル金属化合物は単独で使用し得るのみならず、二種 以上を混合して用いることも可能である。アルキル金属 化合物の使用量は、クロム錯体1モルに対して0.1~ 10000当量であり、好ましくは3~3000当量、 より好ましくは5~2000当量である。

【0033】本発明において、エチレンの加圧下に当該中性多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させることにより得られるエチレンの三量化

触媒を調整する際のエチレンの分圧は10kg/cm²以上であり、好ましくは10~300kg/cm²である。それにより、高い触媒活性を有するエチレンの三量化触媒が得られる。

【0034】本発明のエチレン加圧下において、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させることにより得られるエチレンの三量化触媒は、前記のクロム錯体とアルキル金属化合物とエチレンを原料に、溶媒中で接触させることにより調製できる。接触方法は特に制限されない。

【0035】この触媒を調製する際のクロム錯体の濃度 は特に制限されないが、通常、溶媒11あたり0.00 1マイクロモル~100ミリモル、好ましくは0.01 マイクロモル~10ミリモルの濃度で使用される。0. 001マイクロモルより小さい触媒濃度では十分な活性 が得られず、逆に100ミリモルより大きい触媒濃度で は触媒活性が増加せず経済的でない。また、ここで用い られる溶媒としては、例えば、ブタン、ペンタン、ヘキ サン、ヘプタン、オクタン、イソオクタン、ノナン、デ カン、シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシクロ ヘキサン、シクロオクタン、デカリン等の脂肪族炭化水 素類、ベンゼン、トルエン、キシレン、エチルベンゼ ン、クメン、トリメチルベンゼン、クロロベンゼン、ジ クロロベンゼン等の芳香族炭化水素類及び塩化メチレ ン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン等の塩 素化炭化水素類が挙げられる。また、反応生成物、即 ち、1-ヘキセンを溶媒として用いることもできる。こ れらの溶媒は、それぞれ単独で使用し得るのみならず、 二種以上を混合して用いることも可能である。ここで、 エチレンの三量化反応時のクロム錯体濃度をコントロー ルする目的で、必要に応じて濃縮や希釈しても差し支え ない。

【0036】また、エチレン加圧下において前記のクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させる際の温度はー100~250℃、好ましくは0~200℃である。接触時間は特に制限されず、1分~24時間、好ましくは2分~2時間である。なお、接触時のすべての操作は、空気と水分を避けて行なうことが望ましい。また、原料及び溶媒は十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0037】本発明のエチレンの三量化反応は、エチレン加圧下において前記のクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させ、エチレンを加圧下のまま反応を行うことができる。接触方法は特に制限されないが、例えば、エチレンの加圧下に、クロム錯体とアルキル金属化合物を接触させて、接触と同時に三量化反応を開始する方法、またはクロム錯体とアルキル金属化合物を前もって接触させた後、エチレンで加圧させて三量化反応を行う方法が採られる。なお、これらの混合順序は特に制限されない。

【0038】本発明におけるエチレンの三量化反応の温

度は、-100~250℃であるが、好ましくは0~200℃である。反応圧力は、反応系がエチレン雰囲気であれば特に制限されないが、通常、0.01~3000kg/cm²であり、好ましくは0.1~300kg/cm²である。反応時間は、通常、5秒~6時間である。また、エチレンは、前記の圧力を保つように連続的に供給してもよいし、反応開始時に前記圧力で封入して反応させてもよい。原料ガスであるエチレンには、反応に不活性なガス、例えば窒素、アルゴン、ヘリウム等が含まれていても何ら差し支えない。なお、エチレン三量化反応のすべての操作は、空気と水分を避けて行うことが望ましい。また、エチレンは十分に乾燥しておくことが好ましい。

【0039】本反応は、回分式、半回分式、連続式のいずれでも実施できる。エチレンの三量化反応終了後、反応液に、例えば、水、アルコール、水酸化ナトリウム水溶液等の失活剤を添加して反応を停止させることができる。失活した廃クロム触媒は公知の脱灰処理方法、例えば、水またはアルカリ水溶液による抽出等で除去できる。生成した1一へキセンは、公知の抽出法や蒸留法により反応液より分離される。また、副生するポリエチレンは、反応液出口で公知の遠心分離法や1ーへキセンを蒸留分離する際の残渣として分離除去することができる。

[0040]

【実施例】以下に、本発明を実施例によりさらに詳細に 説明するが、これらの実施例は本発明の概要を示すもの で、本発明はこれらの実施例に限定されるものではな い。

【0041】IR測定:IRは、島津製作所製 赤外分 光光度計 (FTIR-8100)を用いて、ヌジョール 法で測定した。

【0042】ガスクロマトグラフィーによる分析: 反応液中に含まれる炭素数4~8の生成物の定量は、GLサイエンス製 TC-1のカラムを装着した島津製作所製ガスクロマトグラフ (GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度280℃、検出器温度280℃に設定し、内部標準としてn-ヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.0μ1注入した後、カラムの温度を40℃から250℃まで昇温することにより行った。

【0043】また、炭素数10以上の生成物は、上記ガスクロマトグラフとは別途用意したGLサイエンス製TC-1のカラムを装着した島津製作所製 ガスクロマトグラフ(GC-14A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度300℃、検出器温度300℃に設定し、内部標準としてnーヘプタンを用いた。分析は、このガスクロマトグラフに反応液を1.5µ1注入した後、カラムの温度を50℃

から300℃まで昇温することにより行った。

【0044】気体中に含まれる生成物は、クロムパック製 $A1_2O_3$ /KCIのカラムを装着した島津製作所製ガスクロマトグラフ(GC-9A)を用いて分析した。分析条件は、窒素キャリアを用い、インジェクション温度200℃、検出器温度200℃及びカラム温度120℃に設定し、絶対検量線法を用いた。分析は、このガスクロマトグラフに回収した気体を0.2mI注入することにより行った。

【0045】参考例1

内容積100mlのシュレンク管に、J. Amer. Chem. Soc., 92,5118(1970)に記載の方法で合成した三脚型構造を有するトリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)メタン 126mg、トリス(テトラヒドロフラン)クロムトリクロライド(III)143mg、テトラヒドロフラン20mlを加え、窒素雰囲気下で12時間攪拌した。生成した結晶をろ別し、トリス(3,5-ジメチルー1ーピラゾリル)メタンクロムトリクロライド(III)を得た(IR(ヌジョール):1565cm⁻¹)。以下、この錯体を錯体Aと称する。

【0046】比較例1

温度計及び視拌装置を備えた内容積11のステンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを2.9mgと乾燥したトルエン250mlと350mmo1/1のトリーnーオクチルアルミニウム/トルエン溶液6.5mlを窒素下、室温、絶対圧1kg/cm²で導入し、30分間、1000rpmで混合撹拌した。【0047】反応容器を80℃に加熱し、反応容器内のゲージ圧力が40kg/cm²となるようにエチレンガスを吹き込み、以後、前記圧力を維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

【0048】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

【0049】比較例2

温度計及び撹拌装置を備えた内容積11のステンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを2.9mgと乾燥したトルエン250m1と、350mmo1/1のトリーnーオクチルアルミニウム/トルエン溶液6.5m1を窒素下、室温、絶対圧1kg/cm²で導入した。次に、直ぐさまエチレンを導入し、反応容器内のゲージ圧力を5kg/cm²にし、30分間、1000rpmで混合撹拌した。反応容器を80℃に加熱し、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で40kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水

を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

【0050】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

【0051】実施例1

温度計及び撹拌装置を備えた内容積11のステンレス製耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを2.9mgと乾燥したトルエン250m1と350mmo1/1のトリーnーオクチルアルミニウム/トルエン溶液6.5m1を窒素下、室温、絶対圧1kg/cm²で導入した。次に、直ぐさまエチレンを導入し、反応容器内のゲージ圧力を10kg/cm²にし、30分間、1000rpmで混合撹拌した。反応容器を80℃に加熱し、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で40kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

【0052】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

【0053】実施例2

温度計及び攪拌装置を備えた内容積11のステンレス製 耐圧反応容器に、参考例1で合成した錯体Aを2.9m gと乾燥したトルエン250m1と350mmo1/1のトリーnーオクチルアルミニウム/トルエン溶液6.5m1を窒素下、室温、絶対圧1kg/cm²で導入した。次に、直ぐさまエチレンを導入し、反応容器内のゲージ圧力を30kg/cm²にし、30分間、1000 rpmで混合撹拌した。反応容器を80℃に加熱し、反応器内のエチレン圧をゲージ圧で40kg/cm²に維持するように導入し続け、これらの反応条件を保った状態で30分反応を行なった。その後、反応容器中に水を窒素で圧入することにより触媒を失活させて反応を停止した。

【0054】反応容器を室温まで冷却し、次いで脱圧した。反応液及び回収した気体中に含まれる生成物をガスクロマトグラフィーにより分析した。結果を表1に示す。

[0055]

【表1】

医聚番节	実験番号 接触時の圧力(*1)	1一へキャン活性	り 油 柱	木リマー/オリコ'マー	ヒルチー	東分一とこによ	軽 [w代%]	(10 - 海)
	[kg/cm2]	kg/g-Cr/hj	[e/l-無媒溶液/h]	[3/8]	2	90	CBU/E	M
比較例1	1(*2)	9.6	12.0	0~	0.5	72.7	27.1	66
比較例2	5(*3)	9.6	12.0	?	1.7	75.2	23.1	66
実施例1	10(*3)	15.8	19.3	<0.1	<u>0</u> .	85.7	14.2	66
実施例2	30(*3)	22.5	28.4	<0.1	1.0	86.1	13.8	66
<u> </u>	錯体とアルキル金属	L合物を接触させた	- 時点での反応器内の	0压力.				
(*2) 路乘圧	(*2) 陶衆田(衛女田) (*3) 日ナフン公田 (*4) 06 気か中の1 - くキセン	ノン公田. (*4)C6店	(*4)06版公中の1ーく中かり					
反応条件:	反応条件: 触媒4: 6.25 mmol, (n-C8H1)3A A/Crモル比=380. エチレン会用: 40ks/cm2. 80%: 30分. 福発後康(1000mm)	-C8H17)3Al: Al/Cr	モルザニ380 エチレン	/4 F 40kg/cm2 8	0°C	が後襲・北	英康(1000 v	(mu

[0056]

三量化反応の結果

【発明の効果】本発明によれば、エチレン分圧が10k 8/c m²以上の加圧下において、三脚型構造を有する中性の多座配位子が配位したクロム錯体とアルキル金属化合物を接触させることにより得られるエチレンの三量化触媒は、安定で取り扱いが容易であり、しかもこれを用いるとエチレンから効率よく、かつ高選択的に1-ヘキセンを製造することができる。

フロントページの続き

Fターム(参考) 4G069 AA06 AA08 AA09 AA11 BA27A

BA27B BA27C BC04A BC10A

BC16A BC16B BC35A BC58A

BC58B BC58C BD03A BD**07**A

BD08A BD11A BE02A BE05A

BE33A BE45A CB47 DA02

4H006 AA02 AC29 BA02 BA06 BA07

BA14 BA31 BA46

4H039 CA29 CL19